⁰³ Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TIGaTe₂

© Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

E-mail: sardarli@yahoo.com

(Поступила в Редакцию 17 ноября 2010 г. В окончательной редакции 18 января 2011 г.)

Исследованы температурно-частотные зависимости диэлектрической проницаемости и проводимость кристаллов TIGaTe₂. Обнаружено наличие сильной диэлектрической релаксации. Показано, что механизм диэлектрической релаксации связан с перескоком ионов TI по вакансиям в подрешетке таллия вследствие перехода системы в суперионное состояние.

1. Введение

Полупроводниковые кристаллы TlGaTe2 принадлежат к классу соединений $A^3B^3C_2^6$ и кристаллизуются в тетрагональной пространственной группе D_{4h}^{18} (структурный тип TlSe). Из соединений этой группы наиболее изучены TISe и TIS (являющиеся структурными аналогами TlGaTe₂) [103]. Характерной особенностью кристаллов указанного типа является то, что они представляют собой цепочки Ga-Te, вытянутые вдоль тетрагональной оси с кристалла. Тетрагональная ось является оптической осью. Одновалентные атомы Tl⁺ имеют октоэдрическое окружение атомами Те. Из кристаллохимических соображений можно полагать, что структура TlGaTe₂ в наибольшей степени способствует мобильности катионов Tl⁺. Благоприятствующим фактором здесь выступает наличие обширных полостей, соединяющихся между собой через общие грани-окна проводимости, а также принципиальная возможность существования дефицита по одновалентным ионам таллия. Такая дефицитность способна существенно усилить ионную проводимость.

Расчет зонной структуры TlGaTe₂, выполненной методом псевдопотенциала, приводится в работе [4]. Эти вычисления показали, что потолок валентной зоны находится в высокосимметричной точке T на поверхности зоны Бриллюэна, а дно зоны проводимости — на линии D. Наименьший по энергии прямой переход осуществляется между состояниями T_3 и T_4 ; он запрещен в дипольном приближении. Ширина запрещенной зоны, полученная на основе проведенных расчетов, оказалась равной 0.86 eV.

Валентные зоны, согласно [4], условно разделяются на три группы. Самая нижняя около -11 eV сформирована 5*s*-состояниями Те. Другая группа в области -(4-6) eVв основном обусловлена 6*s*-состояниями Tl и 4*s*-состояниями Ga. Верхняя группа в области 0-4 eV образована из 5*p*-состояний Te, 6*p*-состояний Tl и 4*p*-состояний Ga. Эти данные согласуются с результатами работы [5], где изучены фотоэмиссионные спектры, а также методом присоединенных плоских волн рассчитана зонная структура TlGaTe₂.

В предыдущей нашей публикации [6] исследованы температурные зависимости электропроводности и вольт-амперные характеристики (ВАХ) кристаллов ТІGаТе₂, подвергнутых у-радиации. Было установлено, что проводимость в омической области ВАХ имеет прыжковый характер и описывается в приближении Мотта, при этом нелинейная область ВАХ кристаллов TlGaTe₂ описывается в рамках термополевого эффекта Пула-Френкеля. Измерения были выполнены в температурной области 90-300 К. В работе [7] исследована электрическая проводимость и эффект Холла в TlGaTe₂, определены энергии активации и холловская подвижность носителей. Авторы [8] при исследовании нелинейной области ВАХ наблюдали вольтовы осцилляции, которые продолжались неопределенно долго. Частота осцилляций была в пределах нескольких герц, имела хаотический характер и менялась со временем.

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований температурно-частотных зависимостей диэлектрической проницаемости и проводимости, анизотропии диэлектрических свойств соединения TlGaTe₂. Анализ результатов измерений проводится для температур выше 300 К.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Для измерений температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и электропроводности кристаллов TlGaTe₂ были изготовлены конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемого материала. Обкладки конденсаторов были получены нанесением серебряной токопроводящей пасты на поверхности пластинок. Исследования комплексной диэлектрической проницаемости ($\varepsilon^* = \varepsilon' + \varepsilon''$) и электропроводности проводились цифровым измерителем иммитанса E7-20 на частотах 0.5–1000 kHz в интервале температур 100–450 K. Амплитуда измерительного поля не превышала 1 V·cm⁻¹.

Как известно [9,10], в соединениях с суперионной проводимостью при повышении температуры кроме экспоненциального роста электропроводности наблюдается также и экспоненциальное возрастание диэлектрической проницаемости.

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(T)$ и тангенса угла диэлектрических потерь tg $\delta(T)$ соединения TlGaTe₂ для разных частот измерительного поля приведены на рис. 1 и 2. Измерения выполнены перпендикулярно (рис. 1) и параллельно (рис. 2) кристаллографической оси с в интервале температур 100-450 К. Из рисунков видно, что с ростом температуры наблюдается возрастание значения диэлектрической проницаемости є'. При этом чем выше частота измерительного поля, тем позднее начинается рост ε' . Как видно, диэлектрическая проницаемость остается практически неизменной ($\varepsilon' \approx 40$) до температур $\approx 200 \, \mathrm{K}$ во всем изученном диапазоне частот. При температурах 275 и 340 К наблюдаются две особенности в зависимости $\varepsilon'(T)$ и два максимума на зависимости tg $\delta(T)$. С ростом частоты измерительного



Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(T)(a)$ и тангенса угла диэлектрических потерь (b) кристалла TIGaTe₂ на частотах 0.5 (1), 1 (2), 20 (3), 50 (4), 100 (5), 500 (6) и 1000 kHz (7). Измерения выполнены перпендикулярно оси c. На вставке — температурная область аномалии на кривой 7, соответствующей переходу в суперионное состояние.



Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(T)(a)$ и тангенса угла диэлектрических потерь (b) кристалла TIGaTe₂ на частотах 10 (1), 100 (2), 500 (3) и 1000 kHz (4). Измерения выполнены параллельно оси с. На вставке — температурная область аномалии на кривой 4, соответствующей переходу в суперионное состояние.

поля особенности на кривых tg $\delta(T)$ и $\varepsilon'(T)$ смещаются к более высоким значениям температуры, а соответствующие величины при этом падают.

Поведение максимумов кривых зависимостей $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ при приложении поля вдоль кристаллографической оси *c* (рис. 2) аналогична поведению максимумов кривых $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ для ориентации поля перпендикулярно оси *c* (рис. 1).

Полученные зависимости $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ имеют явно выраженные особенности, характерные для релаксационных процессов дебаевского типа с участием многих релаксаторов.

Частотная зависимость $\varepsilon''(\varepsilon')$ в параметрическом виде, т.е. в виде диаграмм Коул–Коула, аппроксимируется линейным отрезком (рис. 3). По-видимому, это обусловлено значительным различием параметров большого набора релаксаторов. Кроме того, подобное поведение частотной зависимости $\varepsilon''(\varepsilon')$ можно объяснить влиянием локализованных состояний носителей заряда на поляризацию в переменном электрическом поле. На данном этапе нам представляется возможным описать близкую к линейной зависимость $\varepsilon''(\varepsilon')$, полученную в рамках универсального закона Джоншера, основанного на энергетическом подходе [11]. В его модели поляри-



Рис. 3. Частотные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости (диаграмма Коул–Коула) для соединения TlGaTe₂, представленные в комплексной плоскости (f = 0.5-500 kHz). Измерения выполнены перпендикулярно оси *c*. Номера точек соответствуют рис. 1.

зация связывается с прыжками носителей (ионов или электронов) по позициям, занятие которых энергетически выгодно вследствие создания в кристалле электрического поля. Дискретное смещение зарядов сопровождается экранированием возникающей поляризации за счет релаксации решетки. Поляризация кристалла TlGaTe₂, по всей видимости, связана с диффузией ионов Tl⁺¹ по вакансиям, которая в конечном итоге приводит к переходу кристалла в суперионное состояние при температуре ~ 300 K [12].

Температурные зависимости электропроводности образца TIGaTe₂ были изучены нами ранее в работе [6] (в температурной области до 300 K). Электропроводимость выше 300 K обнаруживает линейный участок в зависимости ($\lg \sigma T$ от $10^3/T$), при этом наблюдается экспоненциальный рост электропроводности с энергиями активаций $\Delta E_{\parallel}^{\sigma} = 0.21 \pm 0.02 \text{ eV}$ и $\Delta E_{\perp}^{\sigma} = 0.11 \pm 0.02 \text{ eV}$ для измерений, выполненных на частоте 1 MHz. Наблюдаемая анизотропия энергии активации связана с анизотропией проводимости одномерного (1D) кристалла TIGaTe₂. Известно, что такой характер электрической проводимости указывает на преобладающий ионный характер проводимости выше критической температуры.

При нормальных условиях, т.е. в температурной области до перехода в состояние с суперионной проводимостью, система находится в состоянии с элементами беспорядка. При повышении температуры создаются точечные дефекты Френкеля, т.е. узловые ионы попадают в междоузлие, оставляя вакансию. Одной из причин возникновения суперионной проводимости считается множественное, или коллективное, взаимодействие всей совокупности междоузельных ионов и оставленных ими вакансий. При некоторой температуре наступает кризис — число дефектов возрастает лавинообразно. При высоких концентрациях дефектов, вносящих глубокие уровни в запрещенную зону, в полупроводниках могут проявляться динамические эффекты, обусловленные прыжковым обменом зарядами между дефектами [13,14]. Прыжковый обмен носителями заряда между имеющимися в кристалле дефектами приводит к появлению диполей, а следовательно, и к росту диэлектрической проницаемости [13–19].

Таким образом, в дефектных кристаллах при повышении температуры кроме экспоненциального роста электропроводности может наблюдаться экспоненциальное возрастание диэлектрической проницаемости. Всевозможные дефекты, естественно, порождают в запрещенной зоне кристалла энергетические уровни с различной глубиной залегания. Вследствие этого прыжки носителей между локализованными состояниями происходят с участием фононов, а температурная зависимость диэлектрической проницаемости носит экспоненциальный характер [9]

$$\varepsilon(T) \sim \exp(-\Delta E/kT).$$
 (1)

Вычисленные из формулы (1) энергии активации равны $\Delta E_{\parallel}^{\varepsilon} = 0.21 \pm 0.02 \text{ eV}$ и $\Delta E_{\perp}^{\varepsilon} = 0.23 \pm 0.02 \text{ eV}$ (для измерений, выполненных на частоте в 1 MHz и при температурах выше 300 K).

Совпадение температурных участков возрастания диэлектрической проницаемости и проводимости, энергий активации возрастания емкости $\Delta E_{\parallel}^{\varepsilon} = 0.21 \pm 0.02 \,\mathrm{eV}$ и проводимости $\Delta E^{\sigma}_{\parallel} = 0.21 \pm 0.02 \, \text{eV}$, а также наличие частотных зависимостей емкости и проводимости могут свидетельствовать о том, что все перечисленные выше процессы определяются прыжковым обменом зарядами между дефектами вследствие диффузии ионов Tl⁺¹ по вакансиям таллиевой подрешетки и перехода системы в суперионное состояние [12] при температуре выше 300 К. На вставках к рис 1 и 2 в увеличенном масштабе представлены зависимости $\varepsilon(T)$ (при 1 MHz), на которых наблюдаются слабые аномалии, указывающие на изменения в динамической системе кристалла. Следует отметить, что абсолютно противоположная картина наблюдается для измерений перпендикулярно оси с. Энергия активации, рассчитанная из проводимости для измерений перпендикулярно оси $c~(\Delta E_{\perp}^{\sigma} = 0.11 \pm 0.02 \, \text{eV}),$ оказалась ниже, чем энергия активации, рассчитанная из измерений емкости ($\Delta E_{\perp}^{\varepsilon} = 0.23 \pm 0.02 \,\mathrm{eV}$). Такое поведение связано, по всей видимости, с тем, что в этой переходной температурной области (~ 300 K) имеется смешанная электронно-ионная проводимость прыжковая по локализованным состояниям в окрестности уровня Ферми с переменной длиной прыжка и ионная (T1), осуществляемая по дефектной подрешетке таллия в кристалле TlGaTe₂.

Следует также отметить, что в переходной температурной области (~ 300 K), в которой тип проводимости меняется от прыжковой к преимущественно ионной, необходимо учесть возможное возникновение объемных зарядов в приконтактной области [9]. Исследования зависимости падения напряжения от толщины образца, измерения емкости при различных напряжениях не обнаружили заметных изменений в зависимостях $\varepsilon(T)$ и $\sigma(T)$. Это позволяет сделать вывод, что приконтактный слой в кристалле TIGaTe₂, по всей видимости, отсутствовал. Таким образом, экспоненциальный рост в зависимостях $\varepsilon(T)$ и $\sigma(T)$ связан с ионной проводимостью.

В работах [20,21] нами было показано, что положение максимума зависимости диэлектрической проницаемости от температуры $T_{\rm max}$ сильно зависит от частоты измерительного поля. Характерная зависимость диэлектрической проницаемости от температуры и зависимость величины $T_{\rm max}$ от частоты измерительного поля свидетельствуют о релаксационной природе аномалии [17,18]. Последнее предполагает существование в кристаллической решетке слабо связанных с ней электрических зарядов. Это указывает на то, что поляризация в кристалле TlGaTe₂ имеет релаксационную природу. Релаксаторами в кристаллах TlGaTe₂ могут быть ионы Tl⁺, возникающие в результате прыжка из одного локализованного состояния на другое.

Полученные экспериментальные результаты по tg $\delta(T)$ показывают, что с ростом частоты измерительного поля пики tg $\delta(T)$ закономерно смещаются к более высоким температурам, а величина tg δ падает для обоих кристаллографических направлений (рис. 1, *b* и 2, *b*).

Для того чтобы в силу прыжковой перезарядки произошло столь существенное возрастание диэлектрической проницаемости (более чем в 1000 раз), необходимы концентрации дефектов порядка 10¹⁸-10²⁰ сm⁻³. Следует отметить, что такая сравнительно высокая концентрация локализованных состояний в запрещенной зоне характерна для халькогенидов третьей группы (А³В⁶ и $A^{3}B^{3}C_{2}^{6}$) [20–24], кристаллизующихся в слоистую и цепочечную структуры. Вопрос о причинах столь высокой концентрации собственных дефектов в этих кристаллах поднимался каждый раз как при измерениях электропроводности, так и при исследовании диэлектрических свойств. Согласно [24], причиной дефектности структуры может быть наличие широкой области гомогенности кристаллов группы $A^{3}B^{3}C_{2}^{6}$, доходящей до 6-8 mol.%. Коэффициент сегрегации в области гомогенности меньше единицы, поэтому при выращивании монокристаллов существует большая вероятность отклонения состава от стехиометрии. Это в свою очередь будет способствовать возникновению большого количества дефектов стыковки слоев, вакансий, дислокаций. При этом нарушится трансляционная инвариантность кристаллической решетки и, как следствие, возникнут локализованные состояния с энергиями, попадающими в интервал значений, запрещенных в идеальном кристалле. В данном случае выше 300 К электропроводность имеет ионный характер, а прыжковая перезарядка локализованных центров приводит к резкому росту диэлектрической проницаемости.

3. Заключение

В кристаллах TlGaTe₂ перенос заряда осуществляется посредством прыжков носителей заряда по локализованным состояниями вблизи уровня Ферми. Их прыжковая перезарядка приводит к росту диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Скачкообразное разупорядочение кристалла, связанное с переходом в суперионное состояние, сопровождается аномальным поведением электрических и диэлектрических свойств. Показано, что механизм, приводящий к диэлектрической релаксации, связан с перескоком зарядов между заряженными центрами, возникающими в результате перехода системы в суперионное состояние. Последнее связано с диффузией ионов Tl по таллиевой подрешетке кристалла TlGaTe₂.

Список литературы

- С.Б. Вахрушев, Б.Е. Квятковский, Н.М. Окунева, К.Р. Аллахвердиев, Н.А. Бахышов, Р.М. Сардарлы, П.Г. Иванитский, В.Г. Кротенко, В.И. Слисенко. ФТТ 26, 1225 (1984).
- [2] М.В. Белоусов, Р.М. Сардарлы. ФТТ 27, 662 (1985).
- [3] A.M. Panich, R.M. Sardarly. Physical properties of the low dimensional A³B⁶ and A³B³C₂⁶ compounds. Nova Sci. Publ., Inc. N.Y. (2010). P. 287.
- [4] Э.М. Годжаев, Г.С. Оруджев, Д.М. Кафарова. ФТТ 46, 811 (2004).
- [5] K. Okazaki, K. Tanaka, J. Matsuno, A. Fujimori, L.F. Mattheiss, S. Iida, E. Kerimova, N. Mamedov. Phys. Rev. B 64, 4, 045 210 (2001).
- [6] Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Г.Р. Сафарова. ФТП 44, 610 (2010).
- [7] A.F. Qasrawi, N.M. Gasanly. J. Phys.: Cond. Matter 21, 235 802 (2009).
- [8] M.H. Hanias, A.N. Anagnostopoulos. Phys. Rev. B 47, 4261 (1993).
- [9] Л.С. Парфеньева, А.И. Шелых, И.А. Смирнов, А.В. Прокофьев, В. Ассмус. ФТТ 46, 998 (2004).
- [10] Л.С. Парфеньева, А.И. Шелых, И.А. Смирнов, А.В. Прокофьев, В. Ассмус, Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский, И.Г. Васильева. ФТТ 45, 1991 (2003).
- [11] A.R. Jonscher. Scientific papers of the Institute of Electrical Ensineering Fundamentals. Ser. Wspolpraca (Wydavnictwo Politechnik Wroclawskiej, Wroclav) 16, 1, 5 (1977).
- [12] R.M. Sardarly, O.A. Samedov, A.P. Ablullaev, F.T. Salmanov, A. Urbanovich, F. Garet, J.-L. Coutaz. Abstracts 17th Int. Conf. on ternary and multinary compounds. Baku (2010). P. 79.
- [13] П.В. Жуковский, А. Родзик, Ю.А. Шостак. ФТП 31, 714 (1997).
- [14] П.В. Жуковский, Я. Партыка, П. Венгерек, Ю.В. Сидоренко, Ю.А. Шостак, А. Родзик. ФТП **33**, 270 (1999).

- [15] М.Д. Волнянский, М.П. Трубицын, Яхья Ф.Х. Обайдат. ФТТ **49**, 1385 (2007).
- [16] О.Н. Чугай, А.С. Герасименко, В.К. Комарь, Д.С. Морозов, С.В. Олейник, В.М. Пузиков, И.М. Ризак, С.В. Сулима. ФТТ **52**, 2307 (2010).
- [18] Т.В. Панченко, Л.М. Карпова, В.М. Дуда. ФТТ **42**, 671 (2000).
- [19] А.К. Иванов-Шиц, И.В. Мурин. Ионика твердого тела. Изд-во СПбГУ, СПб (2000). Т. 1. 616 с.
- [20] Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, И.Ш. Садыхов, А.И. Наджафов, Ф.Т. Салманов. ФТТ 47, 1665 (2005).
- [21] R.M. Sardarly, B.T. Mamedov, K. Wakita, Y. Shim, A.I. Nadjafov, O.A. Samedov, E.A. Zeynalova. Phys. Status Solidi A 203, 11, 2845 (2006).
- [22] Ф.Н. Абдуллаев, Т.Г. Керимова, Н.А. Абдуллаев. ФТП 47, 1180 (2005).
- [23] С.Н. Мустафаева, В.А. Алиев, М.М. Асадов. ФТТ 40, 612 (1998).
- [24] Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, И.Ш. Садыхов, А.И. Наджафов, Н.А. Эюбова, Т.С. Мамедов. Неорган. материалы 39, 406 (2003).